

電子顕微鏡による組織解析の精度向上 を目指した解析技術の高度化 一組成分析と三次元的観察の技法改良一

Development of Microstructure Evaluation Techniques Based on Electron Microscopy



*脚注に略歴

- Compositional Analysis and 3D Observation -

原 徹 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 Toru Hara プラットフォーム長

し はじめに

金属材料の組織解析には、電子顕微鏡による観察が重要な 位置を占める。特に鉄鋼材料は複雑な階層組織を持つため、 透過型電子顕微鏡 (TEM) や走査型電子顕微鏡 (SEM)、さ らには光学顕微鏡も含めて種々の観察ツールを最大限に活 用して、ナノからマクロまでのマルチスケールな組織解析を 行っている。

TEMによって転位を観察する手法が1950年代に確立して 以降、TEMにより拡大像と電子回折を併用して組織を解析 する手法は、金属材料の組織を直接的に理解する手段として 多用されている。さらに1980年代にはエネルギー分散型X線 分光 (EDS) や電子線エネルギー損失分光 (EELS) といった 分析装置を装備し、単なる拡大・回折像観察装置から総合的 な組織解析装置として利用されるようになった。その後にレ ンズの球面収差補正技術の実用化が転機となり、より高い原 子レベルの空間分解能と高精度な分析が実現している。一方 SEMについては、1980年代ごろまでにはトポグラフィック な(凹凸の)像を観察する目的で、主にエッチングした組織 や破面解析等に利用されていた。1990年代以降は後方散乱 電子回折 (EBSD) を応用して方位解析ができるようになっ たこと、低加速電圧で多彩なコントラストが撮れるように なったこと等から、SEMの応用範囲が劇的に拡大している。 その結果、例えば転位の観察やキャラクタリゼーションなど

の電子回折を利用した解析のように、以前はTEMでしかで きなかった組織解析の一部分をSEMがカバーできるように なった。それとともにTEMの守備範囲は高空間分解能にシ フトし、より精緻な分析・解析が行われるようになった。そ れらの電子顕微鏡技術の発展に加えて、SEM,TEMを用いた 組織解析に大きく影響を及ぼしたものは集束イオンビーム (FIB)装置である。それまで電解研磨に頼っていた金属材料 のTEM 試料作製は、FIBを用いて必要な局所領域のTEM 試 料を作製することが可能になった。その後にSEM との複合 機FIB-SEM として観察・分析と同時にFIB加工が行えるよ うになっている。

上述したような装置・手法の進展に伴い、観察手法も多様 化した。その流れの中で我々は、基本的な組織観察技術の向上 だけでなく、「TEMでの局所領域分析技術」と「SEMを用い た三次元的観察技術」の開発と応用を、検出器の専門家や装 置メーカーとともに進めてきた。ここからはそのような技術開 発が必要となった背景と、それらの技術の紹介を行いたい。



2.1 背景 一何の情報を得たいか

図1は、鉄鋼材料の組織を走査型透過電子顕微鏡 (STEM) で2004年ごろに観察した例である。この試料はFe-12Crに

^{* 1990}年に筑波大学大学院修士課程を修了後、古河電気工業研究員、帝京大学助手を経て1997年に博士(工学)を取得した。1998年に金属材料 技術研究所(現 物質・材料研究機構)に入所した。超鉄鋼研究センター、ナノ計測センター等を経て、現在、構造材料研究拠点に所属している。

種々の元素を添加した、耐熱鋼の実験のためのサンプルであ る。∂フェライトと焼戻しマルテンサイトから成っており、 さらにCr主体のM23C6析出物とV主体のMX析出物が異相 界面や各種境界、粒内に多数存在している。この観察は析出 物の種類(組成)とそれぞれの分布を知る目的であった。し かし、当時のこのような組織観察においては、その目的の観 察に対する課題が2つあった。一つはEDSによる組成分析に 関わるもので、もう一つは析出物粒子の空間分布の把握に関 わるものである。

まず、第一の課題であるEDS分析については、検出器のエ ネルギー分解能 (Δ E) が低く、複数の元素からのX 線ピー クが重なり、精度の高い分析が困難だという点である。 Δ E は典型的には Δ E = 120~130eV (@MnKa) である。そのた め鉄鋼材料の添加元素として重要な元素の多くにおいて、図 2の白枠に示したように異なる元素からのピーク同士が重 なってしまう。現行の半導体検出器では Δ E~110eV程度が 原理的限界なので、ピークを分離した高精度な解析はできな



図1 鉄鋼材料のSTEMによる観察事例

い。高精度分析の実現のためには、現行とは異なる原理によるX線検出器が必要となる。

二番目の課題は、析出物の空間分布の把握についてであ る。図3は、図1の白破線枠内、異相界面付近をSTEMで EDSマップを取得したものである。上段がSTEM-明視野像、 下段がEDSマップである。青がCr、緑がVを表している。こ のEDSマップを見ると、界面上にはCr主体のM23C6だけで なく、V主体の微小なMXも重なって分布していることがわ かる。この界面上にはこれら二種類の析出物はどう分布して いるかという問いに対しては、三次元的な観察手法が必要と なる。SEM観察では表面にある析出物しか観察できないし、 STEM観察では図1や図3のように投影した状態しか観察で きないからである。

2.2 高いエネルギー分解能を持つEDS検出器の開発¹⁻³⁾

第一の課題に対しては、我々は超伝導遷移端センサ(TES) をSTEMでのX線分析に応用して高いエネルギー分解能を 実現することを試みている。この検出器の特長は、エネル ギー分解能が数eVと従来の半導体検出器(130eV)より一桁 以上高く、かつ、10keV以上の広いエネルギー範囲を一度に 分光できることである。STEMにこの検出器を搭載するた めに、文科省リーディングプロジェクト、JST先端計測プロ ジェクト等で、産官学の共同研究として開発を実施した。こ の検出器の高いエネルギー分解能により、ほぼすべての元素 からのX線ピークを分離して測定することが可能になると同 時に、高いピークーバックグラウンド比(P/B)により微量 添加元素の検出限界が向上することが期待できる。

TESによるX線検出の原理を図4に示す。検出器素子は試 料から発生したX線を吸収するための吸収体、温度計とし てのTES、吸収した熱を逃がすための熱浴からなっている。



図2 EDS分析におけるピークオーバーラップの例:(a) SiとW、(b) V,Cr,Mn,Feのピークオーバーラップ



 図1の白枠部分の(a) 拡大像および(b) EDSマップ。青がCr、緑がV を示す

TESは遷移温度Tcに保持されている。試料で発生したX線 のエネルギーを吸収したことによる吸収体のわずかな温度変 化を、Tcに保持した温度計が大きな抵抗変化として検知す る。TESには定電圧のバイアスがかけられているため、抵抗 増加に対応して電流が減少する。この変化を超伝導量子干渉 素子で増幅してX線パルスのシグナルとして取り出す。この 検出器は、動作温度(超伝導体のTc)が低いほどエネルギー 分解能が向上する。従来比一桁アップのΔE=10eV以下の 高いエネルギー分解能を実現するには、100mK程度の極低 温で検出器を動作させる必要がある。STEM にこの検出器を 搭載するには種々の技術的課題があるが、最終的にはX線ス ペクトルを検出することができるようになった。この検出器 の応用例として鉄鋼中のCoの分析例を図5に示す。CoK は FeK_aと近いためCoが微量の場合は通常のEDS (a) では認 識できないが、TES (b) では分離して測定できる。 図5は近 接ピークの分離の例であるが、鉄鋼中の微量元素の検出感度 (下限値)の向上についても現在検討を行っている。



図4 超伝導遷移端センサ(TES)によるX線検出の原理図

2.3 材料組織の三次元的観察手法の構築4.5)

第二の三次元的観察に関する課題については、FIBとSEM を直交に配置させシリアルセクショニングに最適化した装置 を利用して技法開発を行っている⁵⁾。以下にこの装置のコン セプトを簡単に示す。

一般的なFIB-SEMでは、図6(a)に示すようにFIBと SEMが50~60度程度の角度を持って配置されている。この 場合FIBとSEMとで同じ場所が観察できるので、TEM試料 作製のような、大きなサンプルからSEMで対象とする場所 を探してFIBで加工するという目的ではこの配置が適してい る。しかし、この配置でのシリアルセクショニングの場合は、 図6(b)のように観察視野がSEMに対して垂直ではなく、切 削が進むと視野がずれるという問題が出てくる。図7(a)に 直交配置型の機器配置を示しているが、(b)でわかるように この場合は上記2点が解消される。この配置に関しては装置 メーカー(日立ハイテクサイエンス)にシーズ技術があっ た。我々は2009年頃からメーカーと共同で、特に材料の三次 元的組織解析に適したツールとしてさらに検討を行った。さ らに、この装置の特長である高分解能・高コントラストは



図6 (a) 一般的な FIB-SEM の機器配置。(b) 一般的な FIB-SEM によ るシリアルセクショニングの模式図(文献 5)より転載)



図5 TES検出器による鉄鋼中のCoの検出。(a)通常型検出器、(b)TES型検出器。(該当エネルギー部分を拡大)

SEMの検出器の多様化と加速電圧の低電圧化というSEMの 基本機能の進展があって実現した。我々の場合は加速電圧を 300Vから1kV程度を常用し、スライスのピッチを10nmまた はそれ以下に設定している。

直交配置型FIB-SEMによって、前述した異相界面上の析 出物分布の観察を行った例を示す。図8(a)はFIBで表面を 平滑にした試料のSEM像である。矢印で示した部分が対象 とする界面であり、この界面上の析出物分布を三次元的に 取り出して解析することが目的である。図8(b)は(a)の破 線部分を拡大したものである。異相界面上の析出物の種類、



STEM

図7 (a) 直交配置型 FIB-SEM の機器配置。(b) 直交配置型 FIB-SEM によるシリアルセクショニングの模式図(文献5)より転載)

MX析出物(黒)と $M_{23}C_6$ 析出物(灰色)、がコントラストの 違いとして観察できる。また、MX析出物は ∂ フェライト中 にも観察できる。この像は、加速電圧1kVでSEM光軸上に配 置した環状の二次電子検出器を用いて取得したものである。 この図の紙面に平行な面を上方に配置したFIBで10nmピッ チで切削しSEM観察を繰り返して、シリアルセクショニン グの像のセットを取得した。SEM像は10 μ m四方を1000× 1000pixelで取得しているので、1voxelが10 nm 立方となる。

これらの像から三次元再構築を行ったものを図9(a)に示 す。この図は析出物のみを抽出したものである。さらに着目 していた異相界面を取り出したものが(b)である。粒界上の 析出物分布は不均一であり、粒界三重線に向かって析出物が 小さく疎になっていくことがわかる。また、∂フェライト中 の微細なMXは、厚さ10nm程度のプレート状のものが互い に垂直に三つのバリアントとして析出する。その観察のため に図9(a)から∂フェライト部分を取り出して拡大したもの が図10である。(a)と(b)は見る方向を変えたもので、(b) では一つのバリアントについて、プレート状の析出物の板面 に平行に表示している。このように、直交配置型FIB-SEM によるシリアルセクショニング観察では、三次元再構築後で も、高い空間分解能が維持されていると言える。



図9 (a) 図8に続くシリアルセクショニング観察結果からの三次元再構 築像。(b)(a) より異相界面上の析出物を抽出したもの



図8 (a) 直交配置型 FIB-SEM での FIB 切削面の鉄鋼材料の組織観察 事例。(b) (a) の枠内の拡大図(文献 5)より転載)



図10 図9のδフェライト領域を抽出したもの。異なるバリアントのMX 析出物の形状が区別できる。(a), (b) は見る向きが異なる。(文 献5) より転載)

3 ಕೆಂಗಿ

本稿では、電子顕微鏡による鉄鋼材料の組織観察をさらに 高度化させるために我々が取り組んでいる2つの課題につい て紹介した。一つは電子顕微鏡での組成分析の精度・感度を 向上させるための検出器開発に関わるもので、もう一つは、 三次元的な組織の把握を目指した、直交配置型FIB-SEMに 関するものである。どちらも現在は応用研究を実施しながら 技法のブラッシュアップをしている段階である。新たな応用 研究課題を実施するたびに、多くの場合、装置の機能や性能 についての新たな要求が生じるため、紹介した2つの技術に ついても今後実施すべき改良が多く残されている。解析手法 の追求は終わりがなく、ますます対象が拡がっていると感じ ている。

謝辞

本稿に記した開発研究を実施するために、多くの共同研究 者およびオペレータの皆様にご協力いただきました。また、 超伝導X線検出器を搭載したSTEMの開発においては、JST 先端計測分析技術・機器開発プログラム(要素技術・機器開発) によって日立ハイテクサイエンス、九州大学、宇宙航空研究 開発機構、大陽日酸、日立ハイテクノロジーズ、産業技術総 合研究所との共同研究として実施しました。直交配置型FIB-SEMについては、JSTナノテクノロジープラットフォームの ユーザーの方々とも多くの議論をしました。ここに記して謝 意を表します。

参考文献

- T.Hara, K.Tanaka, K.Maehata, K.Mitsuda, N.Y.Yamasaki, M.Ohsaki, K.Watanabe, X.Yu, T.Ito and Y.Yamanaka : J. Electron Microscopy, 59 (2010) 1, 17, doi : 10.1093/ jmicro/dfp043
- 2)原徽,田中啓一,前畑京介,満田和久:応用物理,81 (2012) 2,139.
- 3) K. Maehata, T. Hara, K. Mitsuda, M. Hidaka, K. Tanaka and Y. Yamanaka: J. Low Temp. Phys., 184 (2016) 1-2, 5, doi: 10.1007/s10909-015-1361-3
- 4) T.Hara, K.Tsuchiya, K.Tsuzaki, X.Man, T.Asahata and A.Uemoto: J. Alloys and Compounds, 577S (2013), 717, doi: 10.1016/j.jallcom.2012.02.019
- 5) 原徹: 顕微鏡, 49 (2014) 1, 53.

(2019年4月11日受付)